



Das Halbleiterschutzgesetz (HalblSchG)

1. Motivation / Historie

Der Entwurf und die Erprobung von neuen Halbleiterarchitekturen ist häufig zeit- und kostenintensiv. Weiterführend fehlt neuen Halbleiterarchitekturen häufig die erfinderische Tätigkeit, da auch die Merkmalskombination innerhalb von Chiparchitekturen zielführend sein kann.

USA 1984:

Semiconductor Chip Protection Act, SCPA → urheberrechtlicher Schutz für Strukturen von dreidimensionalen Halbleitern (mask work)

Europäische Gemeinschaft 1986:

Richtlinie über den Rechtsschutz der Topographien von Halbleitererzeugnissen (87/54/EWG) wurde verabschiedet.

Deutschland 01.11.1987:

Halbleiterschutzgesetz & Halbleiterschutzverordnung. Letzte Änderung am HalblSchG erfolgte am 17.07.2017 → Einführung des Absatzes 3a in §4 HalblSchG, basierend auf der Verordnung (EU) 2016/679 (Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten)

2. Gegenüberstellung HalblSchG und GebrMG

	HalblSchG	GebrMG
Was kann geschützt werden?	Dreidimensionale Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topographien) werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt, wenn und soweit sie Eigenart aufweisen. Satz 1 ist auch auf selbständig verwertbare Teile sowie Darstellungen zur Herstellung von Topographien anzuwenden. (§1 (1) HalblSchG)	Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. (§1 (1) GebrMG)
Zuständigkeit	DPMA (§3 (1) HalblSchG)	DPMA (§4 (1) GebrMG)
Kosten Anmeldung (PatKostG)	- Elektronische Anmeldung: 290€ - Anmeldung Papierform: 300€	- Elektronische Anmeldung: 30€ - Anmeldung Papierform: 40€
Aufrechterhaltungsgebühren (PatKostG)	-	- 4. bis 6. Schutzjahr: 210€ - 7. & 8. Schutzjahr: 350€ - 9. & 10. Schutzjahr: 530€

Was muss die Anmeldung enthalten?	<ol style="list-style-type: none"> 1. einen Antrag auf Eintragung des Schutzes der Topographie, in dem diese kurz und genau bezeichnet ist; 2. Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topographie oder eine Kombination davon und Angaben über den Verwendungszweck, wenn eine Anordnung nach § 4 Abs. 4 in Verbindung mit § 9 des Gebrauchsmustergesetzes in Betracht kommt; 3. das Datum des Tages der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung der Topographie, wenn dieser Tag vor der Anmeldung liegt; 4. Angaben, aus denen sich die Schutzberechtigung nach § 2 Abs. 3 bis 6 ergibt. (§3 Abs. 2 HalblSchG) → §§2 und 3 HalblSchV beachten (§2 (2) HalblSchV: <u>Die Anmeldung muss unter Verwendung des Formblattes des DPMA erfolgen</u>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. den Namen des Anmelders; 2. einen Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters, in dem der Gegenstand des Gebrauchsmusters kurz und genau bezeichnet ist; 3. einen oder mehrere Schutzansprüche, in denen angegeben ist, was als schutzfähig unter Schutz gestellt werden soll; 4. eine Beschreibung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters; 5. die Zeichnungen, auf die sich die Schutzansprüche oder die Beschreibung beziehen. → §§ 2 bis 4 GebrMV beachten
Schutzart	Eintragung in das Register für Topografien (§4 (1) HalblSchG), wobei die Eintragung analog dem GebrMG (§8 Absatz 2 bis 4) erfolgt	Eintragung in das Register für Gebrauchsmuster (§8 (1) GebrMG)
Neuheitsschonfrist	Verwendung bis zu 2 Jahre vor dem Anmeldetag nicht neuheitsschädlich (§5 (1) (1.) HalblSchG)	Offenbarung bis zu 6 Monate vor dem Anmeldetag nicht neuheitsschädlich (§3 Abs. 1 Satz 3 GebrMG)
Prüfung durch DPMA	Nur formale Prüfung (§4 (1) HalblSchG)	Nur formale Prüfung (§8 (1) Satz 2 GebrMG)
Schutzentstehung	1. an dem Tag <u>der ersten nicht nur vertraulichen geschäftlichen Verwertung</u> der Topographie, wenn sie <u>innerhalb von zwei Jahren</u> nach dieser Verwertung <u>beim Patentamt angemeldet</u> wird, oder	Schutzentstehung mit Eintragung ins Register für Gebrauchsmuster (§11 (1) GebrMG)

	2. <u>an dem Tag, an dem die Topographie beim Patentamt angemeldet wird</u> , wenn sie zuvor noch nicht oder nur vertraulich geschäftlich verwertet worden ist. (§5 (1) HalblSchG)	
Schutzdauer	<u>Beginn</u> (siehe Schutzentstehung) <u>Ende</u> : Mit Ablauf des 10. Kalenderjahres nach dem Jahr des Schutzbeginns	<u>Beginn</u> : Anmeldetag <u>Ende</u> : nach 10 Jahren, nach Ablauf des Monats in den der Anmeldetag fällt (§23 (1) GebrMG)
Schutzbereich	Eingereichte Topografie (§6 HalblSchG)	Inhalt der Schutzansprüche (§12a GebrMG)
Wirkung des Schutzes	Topographie darf allein durch den Inhaber des Schutzes verwertet werden. Jedem Dritten ist es verboten: 1. Die Topographie nachzubilden 2. die Topographie oder das die Topographie enthaltende Halbleitererzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verbreiten oder zu den genannten Zwecken einzuführen. §6 (1) HalblSchG	Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat die Wirkung, daß allein der Inhaber befugt ist, den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand des Gebrauchsmusters ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. (§11 GebrMG)
Wirkung des Schutzes erstreckt sich <u>nicht</u>	1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgeschäftlichen Zwecken vorgenommen werden; 2. die Nachbildung der Topographie zum Zwecke der Analyse, der Bewertung oder der Ausbildung; 3. die geschäftliche Verwertung einer Topographie, die das Ergebnis einer Analyse oder Bewertung nach Nummer 2 ist und Eigenart im Sinne von § 1 Abs. 2 aufweist. Wer ein Halbleitererzeugnis erwirbt, ohne zu wissen oder wissen zu müssen, daß es eine geschützte Topographie enthält, kann es ohne Zustimmung des Inhabers des Schutzes weiterverwerten. Sobald er weiß	1. Handlungen, die im privaten Bereich zu nichtgewerblichen Zwecken vorgenommen werden; 2. Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand des Gebrauchsmusters beziehen; 3. Handlungen der in § 11 Nr. 4 bis 6 des Patentgesetzes bezeichneten Art. §12 GebrMG

	oder wissen muß, daß ein Schutz der Topographie besteht, kann der Inhaber des Schutzes für die weitere geschäftliche Verwertung des Halbleitererzeugnisses eine nach den Umständen angemessene Entschädigung verlangen. (§6 (2) & (3) HalblSchG:	
Löschung	Jedermann hat Anspruch auf Löschung (§8 HalblSchG) der Eintragung, wenn: 1. Die Topographie nach § 1 nicht schutzfähig ist, 2. Der Anmelder oder der als Inhaber Eingetragene nicht nach § 2 Abs. 3 bis 6 zum Schutz berechtigt ist oder 3. Die Topographie nicht innerhalb der Frist nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder nach Ablauf der Frist nach § 5 Abs. 4 angemeldet worden ist.	Jedermann hat mittels Löschantrag (§16 GebrMG) Anspruch auf Löschung (§15 GebrMG), wenn: 1. Nicht schutzfähiger Gegenstand nach §§1-3 GebrMG 2. Der Gegenstand des GebrM schon durch frühere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist 3. der Gegenstand des Gebrauchsmusters über den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der 4. sie ursprünglich eingereicht worden ist.
Kosten Löschungsverfahren (PatKostG)	300€	300€

3. Schutzrechtliche Relevanz

Jahr	Neuanmeldungen	Erloschen durch Zeitablauf	Am Jahresende in Kraft
2013	3	8	26
2014	1	4	23
2015	0	4	19
2016	8	1	25
2017	0	2	23

Zum Jahresende 2017 waren aber 4224 Halbleiterformen durch Patente geschützt (IPC: H01L).

4. Quellen

HalblSchG, HalblSchV, GebrMG, GebrMV, Jahresbericht 2017 DPMA, Merkblatt für die Anmelder der Topografien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen, www.dpma.de